1. **森 健, 南川 慶二, 別府 卓 :** アミド基含有高分子化合物およびその製造方法, 特願PCT/JP2006/308986 (2006年4月), .
2. **佐藤 恒之, 平野 朋広 :** 分岐状重合体の製造方法および分岐状重合体含有分散液, 特願2006-218231 (2006年8月), 特開2008-038110 (2008年2月), .
3. **河村 保彦, 津嘉山 正夫, 市川 亮一, 山本 幹二, 佐々木 貴啓 :** スダチチンおよびノビレチンの製造方法, 特願2007-045931 (2007年2月), (2012年11月), 特許第5119397号 (2012年11月).
4. **加藤 雅裕, 米倉 大介, 大西 賢治 :** 粉体取扱装置用鋼製部材及び粉体取扱装置, 特願2007-073841 (2007年3月), 特開2008-230665 (2008年10月), 特許第4064438号 (2008年1月).
5. **平野 朋広, 右手 浩一, 佐藤 恒之, 原口 将幸, 大土井 啓祐 :** 高分岐ポリマーを用いた光パターニング組成物, 特願2008-186586 (2008年7月), 特開2010-24330 (2010年2月), 特許第5473270号 (2014年2月).
6. **百瀬 陽, 右手 浩一, 平野 朋広 :** 共重合体の定量方法, 特願2009-252192 (2009年11月), 特開2011-085564 (2011年4月), 特許第5531563号 (2014年5月).
7. **百瀬 陽, 右手 浩一, 平野 朋広 :** 光学活性芳香族ヒドロキシカルボン酸縮合体の製造方法及び光学活性化合物, 特願2010-107438 (2010年5月), 特開2010-285420 (2010年12月), .
8. **原口 将幸, 大土井 啓祐, 平野 朋広, 右手 浩一, 佐藤 恒之 :** 高分岐ポリマー及びそれを含む組成物, 特願PCT/JP2010/061623 (2010年7月), 特開WO2011/004865 (2011年1月), 特許第5651111号 (2014年11月).
9. **平野 朋広, 右手 浩一, 佐藤 恒之, 原口 将幸, 畑中 辰也, 大土井 啓祐 :** イオン性高分岐ポリマー及び炭素ナノ材料分散剤, 特願2010-161021 (2010年7月), 特開2012-21100 (2012年2月), 特許第5676170号 (2015年1月).
10. **加藤 雅裕, 堀田 雅敏 :** 低温脱着材料・その製造方法及び低温脱着方法, 特願2010-169835 (2010年7月), 特開2012-30152 (2012年2月), 特許第5751464号 (2016年8月).